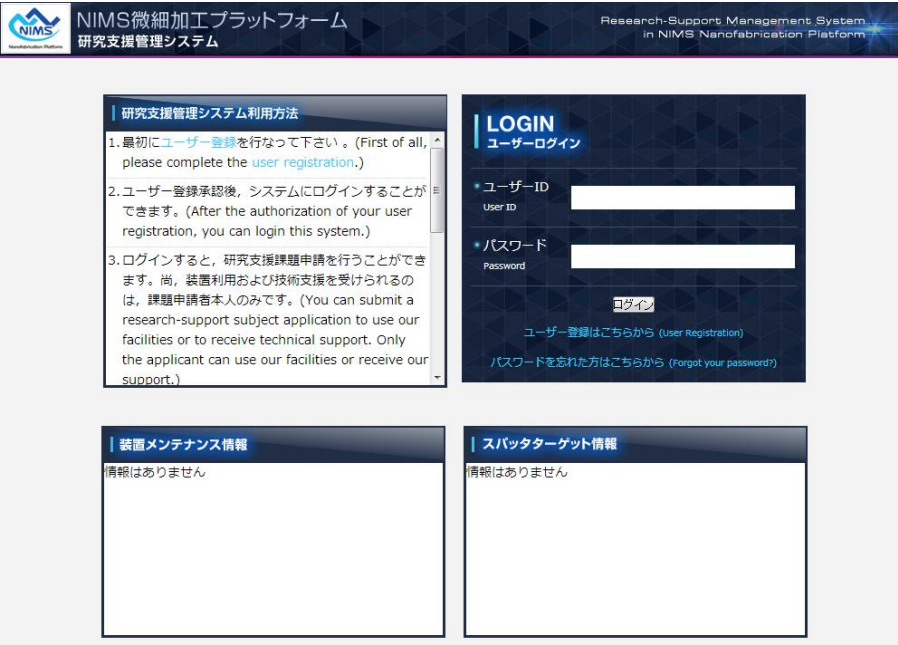


NIMS 微細加工プラットフォーム

研究支援管理システム

(<https://www.nanofab.jp/>)

利用マニュアル



研究支援管理システム利用方法

1. 最初にユーザー登録を行なって下さい。(First of all, please complete the [user registration](#).)
2. ユーザー登録承認後、システムにログインすることができます。(After the authorization of your user registration, you can login this system.)
3. ログインすると、研究支援課題申請を行うことができます。尚、装置利用および技術支援を受けられるのは、課題申請者本人のみです。(You can submit a research-support subject application to use our facilities or to receive technical support. Only the applicant can use our facilities or receive our support.)

LOGIN ユーザーログイン

ユーザーID
User ID

パスワード
Password

ログイン

[ユーザー登録はこちら](#) (User Registration)

[パスワードを忘れた方はこちら](#) (Forgot your password?)

装置メンテナンス情報

情報はありません

スパッターターゲット情報

情報はありません

第五版 平成 30 年 8 月 1 日
第四版 平成 30 年 4 月 1 日
第三版 平成 28 年 4 月 1 日
第二版 平成 25 年 6 月 1 日
第一版 平成 25 年 3 月 1 日

1. 利用に際しての注意事項

- ◆ NIMS 微細加工プラットフォーム（ナノテクノロジー融合ステーションナノファブリケーショングループ）の施設・装置を利用（付き添い等の入室のみも含む）する方は、全員ユーザー登録が必要です
- ◆ 装置の利用、支援を受けられるのは「課題申請者本人のみ」です（課題申請フォームの“共同研究者”が装置を利用するまたは支援を受けることはできません）。
- ◆ 同一ユーザーであっても研究テーマ・支援内容が異なる場合は、それぞれの課題ごとに支援申請が必要です。

2. ユーザー登録

- ① 「[研究支援管理システム](#)」ログインページの「ユーザー登録はこちらから」をアクセスして下さい。
- ② 登録フォームの必要事項に記入し、登録を完了させて下さい。
- ③ 登録フォームに記入した E メールアドレスに『ユーザー仮登録』のお知らせメールが自動配信されます。
- ④ 事務局にて記入に不備がないかどうか等を確認させていただいたのち、『ユーザー本登録』のお知らせメールが配信されます。
- ⑤ 『ユーザー本登録』メールに記載されている「ユーザーID、パスワード」でシステムにログインできます（パスワードはログイン後、自身で変更可能です）。
- ⑥ ユーザー登録のみでは、装置予約表を閲覧することはできません。

3. 新規課題申請

- ① ログイン後、『課題申請・支援履歴』のページを開き、「新規課題申請」にアクセスして下さい。
- ② 必要事項を記入し、課題申請を行なって下さい。
- ③ 申請後、『新規課題申請受付』のお知らせメールが自動配信されます。
- ④ 課題審査ののち、受理された場合は『新規課題申請の審査結果』のお知らせメールが配信されます（審査が完了するまでは申請内容の変更が可能です）。
- ⑤ 課題が受理されたのち、装置利用および支援を受けることが可能となります。

4. 装置予約

- ① 自身で装置予約を行うためには、装置ごとの「**機器利用ライセンス**」を取得する必要があります。ライセンスを取得していない場合は、支援員にメールもしくは電話等で予約を依頼して下さい。尚、ライセンスを取得していない場合は、原則「技術補助もしくは技術代行」での利用となります。
- ② 機器利用ライセンスを取得している場合は、『装置予約』にアクセスして下さい。

- ③ 開始時間，終了時間，装置名，課題を選択し，予約を行なって下さい（**複数件の支援課題を有している方は課題の選択を間違えないようにお願いします**）。
- ④ **ユーザー自身による予約は，前営業日から変更・キャンセルができません**ので，ご注意願います（配慮すべき事情がある場合に限り，変更・キャンセルいたしますので，その際は支援員にお声掛け下さい）。
- ⑤ 自分の予約は橙色で表示され，他人の予約は灰色で表示されます。

5. ライセンス取得方法

- ① 機器利用ライセンスを取得したい場合は，まずその旨を支援員に伝え，装置の操作トレーニングを受けて下さい（操作トレーニングの際は“技術補助”として課金されます）。
- ② ライセンス取得までの基本的な流れ
 - 1回目：支援員による操作説明の受ける
 - 2回目：支援員の立ち会い，指導の下，ユーザー自身にて装置操作を行う
 - 3回目：支援員の立ち会いの下，指導無しでユーザー自身にて装置操作を行う
- ③ 前述の3回目で，装置操作に問題が無いと支援員が判断した場合に機器利用ライセンスが付与され，次回以降は自身で予約・利用ができます。

6. 保有ライセンスの確認方法

- ① ライセンスを取得すると，マイページに『ライセンス』が追加されます。

ライセンス	
ライセンス License	【リソグラフィー装置/Lithography System】 電子ビーム描画装置/EB Lithography レーザー露光装置/Laser Lithography
	【薄膜形成装置/Thin Film Deposition System】 全自動スパッタ装置/Automatic Sputter 12連電子銃型蒸着装置/12 E-gun Evaporator
	【ドライエッチング装置/Dry Etching System】 多目的ドライエッチング装置/CCP-RIE
	【プロセス評価・観察装置/Characterization & Observation System】 走査電子顕微鏡/FE-SEM 原子間力顕微鏡/AFM
	【切削・研磨装置/Cutting & Polishing System】 自動スクライバー/Auto Scriber
	【電気特性評価装置/Electric Measurement System】 室温プローバシステム/Room Temp. Prober

7. 利用料金・使用履歴の確認方法

- ① 利用料金・・・ログイン後，『課題別利用料金』にて利用料金が確認できます（複

数件の課題がある場合は課題ごとに料金表示されます)。

- ② 利用履歴・・・利用料金の金額にアクセスすると、その内訳（履歴）が確認できます。

8. 外部発表登録の方法

NIMS 微細加工プラットフォームの利用，または支援を受けて得られた成果を学会や論文等で発表する（発表した）場合は，外部発表登録を必ず行なって下さい。登録の対象は下記の通りです。

- ◆ 学術論文・雑誌
- ◆ 国際学会・会議
- ◆ 国内学会・会議
- ◆ 特許出願
- ◆ プレスリリース
- ◆ その他（卒業・修士・博士論文発表なども含め，非公開での発表など）

- ① ログイン後、『外部発表登録』のページを開き、「新規登録」にアクセスして下さい。
- ② 発表形式を選択して下さい。
- ③ 以後，ページに記載されている必要事項を入力して，登録完了して下さい。
- ④ 登録後は自身にて登録内容の修正・変更が可能です。例えば，投稿中の論文が出版された場合などは，「投稿中」から「出版済」に変更し，内容を更新して下さい。